PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-064840

(43) Date of publication of application: 12.04.1984

(51)Int.CI.

G03C 1/72 G03F 7/08

(21)Application number: 57-175177

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

05.10.1982

(72)Inventor: NAGASAKA HIDEKI

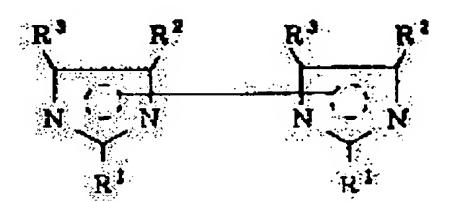
TAKAHASHI NORIAKI

(54) PHOTOSENSITIVE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a positive type photosensitive composition having high sensitivity and capable of being spectrally sensitized by incorporating a specified compound, hexarylbiimidazole and an alkali-soluble org. polymer.

CONSTITUTION: One or more kinds of compounds (A) selected from ethanol— amine derivs., benzaldehyde derivs., adducts of acid chlorides such as acetyl chloride to pyridine, and dibasic carboxylic acid anhydrides such as phthalic anhydride are mixed with hexarylbiimidazole (B) represented by the formula (where each of R1WR3 is aryl, and each ring is aromatic nonlocalized electrons satisfying the valences of the constituent atoms of each imidazolyl ring) and an alkali—soluble org. polymer (C) such as a methacrylic acid—styrene copolymer in (0.1W0.6):(0.1W0.6):1 weight ratio. The mixture is dissolved in a solvent such as methyl ethyl ketone and applied to a support.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—64840

5 Int. Cl.³

G 03 F

G 03 C 1/72

7/08

識別記号

庁内整理番号 7267—2H 7124—2H 砂公開 昭和59年(1984) 4月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈感光性組成物

2)特

願 昭57—175177

22出

1 昭57(1982)10月5日

⑫発 明 者 長坂英樹

横浜市緑区鴨志田町1000番地三 菱化成工業株式会社総合研究所

内

⑫発 明 者 高橋徳明

横浜市緑区鴨志田町1000番地三菱化成工業株式会社総合研究所

内

⑪出 願 人 三菱化成工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番2号

9代 理 人 弁理士 長谷川一 外1名

明細

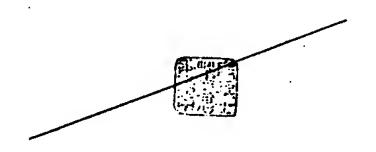
- / 発明の名称 感光性組成物
- 2 特許請求の範囲
 - (1) (a) エタノールアミン誘導体、ベンズアルデヒト誘導体、酸クロライドとピリジンとの付加物または二塩基性カルボン酸無水物、(b) ヘキサアリールピイミダゾール、および、(c) アルカリ可溶性有機重合体を含有することを特徴とする感光性組成物。

3 発明の詳細な説明

本発明は、ボジ型レリーフ像を与える新規な 感光性組成物に関するものである。特に、分光 増級が可能な高感度ボジ型感光性組成物に関す るものである。

従来、ポジ型レリーフ像を与える感光材料としては、。一ナフトキノンジアが勝導体をリーカリ可称性結合を関係を中でのアルカリ可称性結合に、ないないではない。確かにはないではないではないでは、ないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないないでは、から使用光源の波及域を自由に、対して、がら使用光源の波及域を自由に、対して、がらには、から使用光源の波及域を自由に、対象により、発像性を低下させる。

かかるポジ作用を示す異なる感光系として、 従来、いくつかの提案がなされてきた。例えば、



ピニルケトン類の共重合体 (Ultraviolet Light Induced Reactions in Polymers, P. 272,281,307; ACS Symp. Ser 25) 、光分解性酸発生剤とエー テル基含有主鎖構造を有するポリマーとの系 (・特開昭 55-12995号、同 56-17345号、 米国特許第 3 7 7 9 7 7 8 号、西独公開特許第 26/0842号、同27/8254号)、二トロ芳 香族化合物をポリマーに添加混合もしくは結合 させた系(時開昭 53-133022 号、西独公開 特 許 第 9 3 6 3 7 1 号 、 同 2 1 5 0 6 9 1 号 、 同 2242106号、同2242394号、米国特許第 3991033号、英国特許第1158843号)、 光重合禁止剤を含む光重合系(特開昭50-4562号、同52-111985号)、ピイミダ ソールと檄可辞性樹脂との系(英国特許第 1168182号)、 ビイミダゾールとジヒドロ ピグシンとの系(特公昭が6-44416号)など が挙げられるがこれらの系は感度、作業性、現 像特性などまだ多くの課題が残されていた。

これら従来技術の欠点に鑑み、本発明者らは

- 3 -

本発明組成物を構成する第2の成分(b)はヘキサアリールピイミダゾールである。これは 2.4、
5 ートリアリールイミダゾリル二量体ともいわない。 1 個のイミダゾールが 1 個の共有結合した構造を有し、一般式

校討を重ねた結果、優れた特性を有する新規感 光系を見い出した。

即ち、本祭明の要旨は、(a) エタノールアミン 誘導体、ペンズアルデヒド誘導体、酸クロライ ドとピリジンとの付加物または二塩蒸性カルポ ン酸無水物、(b) ヘキサアリールピイミダゾール、 および、(c) アルカリ可溶性有機重合体を含有す ることを特徴とする感光性組成物に存する。

本発明を更に詳細に説明するに、本発明は活性光線の作用によりポジ型作物する新規な感光性組成物を提供するものであり、該組成物は次の3成分を必須の構成々分とする。

第1の成分(a)は下記の化合物群より選択される少なくとも一種の化合物であり、具体的には、例えば、モノエタノールアミン、ジェタノールアミン、トリエタノールアミン、Nーメチルジェタノールアミン、Nーフエニルジェタノールアミン等のエタノールアミン類;テレフタルアルデヒド、コダージメトキシペンズアルデヒド、コーニ

(式中、R'、R'、R'はアリール等を示し、点線の円はイミダゾリル環の構成原子の原子価を満足する芳香族性非局在化電子を示す。)で表わされる。

 4.2'-ピス(o ープロモフエニル) ー 4,4',5,5'
ーテトラフエニルピイミダゾール、 2,2'ーピス
(o , p ー ジクロロフエニル) ー 4,4',5,5'ーテトラフエニルピイミダゾール、 2,2'ーピス(o ー クロロフエニル) ピイミダゾール、 特に好ましくは、 2,2'ーピス(o ー クロロフエニル) ー 4,4',5,5'ーテトラフエニルピイミダゾール等があげられる。 これらのヘキサアリールビイミダゾール第グンール類は例えば Bull. Chem. Soc. Japan, 33 , 565 (/ 9 6 0) および J. Org. Chem. 36 (/ 6) 2 2 6 2 (/ 9 7 /) に 開示されている方法により容易に合成することができる。

本祭明の相成物を構成する第3の成分(e)はアルカリ可溶性有機重合体である。該重合体としては、例えば、アクリル酸またはメタクリル酸の一連の共重合体、具体的には、メタクリルを
グメチルメタクリレート共重合体、メタクリル
酸とスチレン、酢酸ピニル、またはピニルピリ
リドンのいずれかとの共重合体、あるいは、メ

- 7 -

以上述べた賭成分は、適当な溶媒を用いて溶解混合し、支持体上に強布される。好適な溶媒としては例えば、メチルエチルケトン、アセトン、シクロヘキサノン、トルエン、シメチルホルムアミド、エタノール、メチルセロソルブ、マントキソン等がある。支持体としては目的用途に応じて異なるが、例え

タクリル酸、イタコン酸およびマレイン酸誘導体と前述したスチレン、酢酸ピニルまたはピニルゼロリドン等の共分体との組合せから成る共重合体、その他、「ノポラツク」の名称で知られているフェノールーホルムアルデヒド樹脂を挙げることができる。特に、メタクリル酸/メチルメタクリレート共重合体が好適に使用できる。

本発明においては、前記成分(a)は、例えば、 メチルメタクリレート/Nーメタクリルピリジ ニウムクロリド/メタクリル酸ターポリマー、 メチルメタクリレート/メーホルミルフエニル メタクリレート/メタクリル酸ターポリマー等 の様に前記成分(e)に導入しておいてもよい。

以上本発明の感光性組成物の各成分について具体例を示したが、これらJ成分の使用割合は、重量比で(a):(b):(c)= α / ~ α 6: α / ~ α 6: 1 / α 6

- 8 -

ば、アルミニウム、銅、亜鉛などの金属シート、ポリエチレンテレフタレート、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリスチレンなどのポリマーシート、その他紙類、ガラスシート等にも適用できる。

か様にして作成された感光部材は 画像状に 解 光され、次いでアルカリ性現像液により現像される。その結果、 解光部が洗去され支持体上に ポジ型レリーフ像が形成される。

本発明の組成物に適用し得る解光光源としてはカーボンアーク、高圧水銀魚、キセノンランプ、メタルハライドランプ、後光ランプ、タンクステンランプ、アルゴンイオンレーザー、ヘリウムカドミウムレーザー、クリプトンレーザー等 180 mm 以上の紫外線、可視光線を含む汎用の光源を好滴に使用し得る。

本発明の光重合性組成物は広範囲な応用分野に有用であつて例えば平版、凹版、凸版等の印刷版の作成、ブリント配額やICの作成の為のフォトレジストや、ドライフイルム、レリーフ

像、非銀塩リスフイルム、面像複製などの面像 形成等に利用できる。

以下、本発明を実施例ならびに比較例により 具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に 限定されるものではない。

奥施例/

- 11 -

デヒド、即ち、テレフタルアルデヒド、ローニトロペンズアルデヒド、pーアセトアミドペンズアルデヒド、3.4ージメトキシペンズアルデヒド、pークロロペンズアルデヒドに代えたところほぼ同様の感度を示した。

奥施例10~12

寒施例 / においてトリエタノールアミンに代え、塩化ペンソイル/ピリジン等モル付加物を用いた以外は寒施例 / と同様な条件下で検討を行なつた。その結果、優れた陽画像が得られる段クリアー感度を示した。更に、塩化ペンクタノイル/ピリジン等モル付加物に代え、塩化アクリイル/ピリジン等モル付加物を用いた場合もほぼ同様な感度を示した。

実施例!3~15

実施例 / のトリエタノールアミンに代え、無水コハク酸を用いた以外は実施例 / と同様な条件下で検討を行なつた。その結果、陽画像が得られる段クリアー底度を示した。更に無水コハ

て解光した。解光条件は高圧水銀燈(光隙度 & 0 mw/cm)、5 分間照射であつた。次にプチルセワソルプ4 5 重量 5、ケイ酸ソーダュ5 重量 5 を含む水溶液に 2 分間浸漬したところ、館 光部の感光層が溶解除去され後れた陽画像を得た。またステップ感度は 4 段クリアーを示した。実施例 2 および 3

実施例!で用いたトリエタノールアミンに代え、ジエタノールアミン及びNーフエニルジエタノールアミンを用いた他は実施例!と同様条件で行なつた結果、優れた陽画像が得られ、各々な段クリアー及び3段クリアーのステップ感度を示した。

実施例 4~9

実施例!る

実施例 / においてトリエタノールアミンに代え、ョージエチルアミンベンズアルデヒドを用いた以外は実施例 / と同様な条件下で検討を行なつた。その結果、優れた陽画像が得られ、J 及クリアー感度を示した。更に、ョージエチルアミノベンズアルデヒドを他の催換ベンズアル

- 12 -

ク酸に代え、無水マレイン酸、無水フタル酸を 用いた場合もほぼ同様な感度を示した。

ノボラック樹脂 B K ー a (住友ジュレス社製) ノチ、。ーニトロペンズアルデヒドの s チ、 2,2'ーピス(。ークロロフエニル)ー 4,4',5,5' ーテトラフエニルピイミダゾールの a g および ・ピクトリアピュアブルー『B O H 8 叫をメチ ルエチルケトン 1 8 6 4 第 4 1 日標

ルエチルケトン!99に溶解し実施例!と同様に試料を作成し、欝光を行なつた。次いで、水酸化ナトリウム!重量る、ケイ酸ソーダョ重量を含む水溶液によりょ分間の浸渍現像を行なった結果、優れた陽画像を得た。ステップ感度は2段クリアーであつた。

比較例/

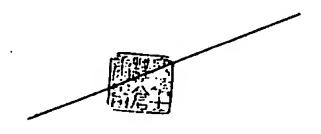
実施例 / 4 においてピイミダゾールを除いた 以外は同一の条件下で評価を行なつた。得られ た面像は画線部が剝離し劣悪な画像特性を示し た。

寒施例 / 7

実施例 / で用いたものと同一の感光液に更に 増感剤としてユーロージエチルアミノスチリルベンソチアゾール 8 0 砂を添加した以外は実施 例 / と同様な条件下で検討した。その結果、後 れた陽画像が得られ、ステップ感度は 8 段クリ アーであつた。

実施例 / 8

実施例 / うで用いた増感剤に代え、表 / 記載の増感剤を使用し、同様に試料を作成した。キセノン母分光照射装置(ナルミ社製)を用いて分光感度特性を調べた。結果を表 / に示すがいずれも良好な分光感度を有することが分つた。



- 15 -

イミダゾールに代え、 2,2'ーピス(o ープロモフエニル) ー 4,4',5,5'ーテトラフエニルピイミダゾール及び 2,2'ーピス(o,pージクロロフエニル) ー 4,4',5,5'ーテトラフエニルピイミダゾールを用いた以外は実施例 / 1 と同一条件下で検討した。その結果、共に優れた陽画像が得られ、クリアー感度は各々 8 5 段及び 8 段を示した。

出願人 三菱化成工衆株式会社 代理人 弁理士 長谷川 - 任か/名

表

使用增感剂	分光感度長波長端
2-(p-ジエチルアミノスチリル)- ペンゾ[45]ペンゾチアゾール	\$00 nm
pージメチルアミノスチリルフエニルケ トン	\$00 nm
ユージベンゾイルメチレンー / ーメチル ーベン[4 5] ベンゾチアゾリン	<i>440</i> n m
ん8ージメトキシアントラキノン	430 nm
4 4'- ピス(ジメチルアミノ)ベンゾフ エノン	425 a m

実施例 / 9 および 2 0

実施例 / 1 化於て用いた 2,2'ーピス (o ー クロワエニル) ー 4,4',5,5'ーテトラフエニルビ

- 16 -